

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】令和1年9月5日(2019.9.5)

【公開番号】特開2018-117020(P2018-117020A)

【公開日】平成30年7月26日(2018.7.26)

【年通号数】公開・登録公報2018-028

【出願番号】特願2017-6178(P2017-6178)

【国際特許分類】

H 01 L 23/50 (2006.01)

【F I】

H 01 L	23/50	H
H 01 L	23/50	A
H 01 L	23/50	D
H 01 L	23/50	R

【手続補正書】

【提出日】令和1年7月26日(2019.7.26)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項6

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項6】

前記レジストマスクを形成する工程において、前記銅板の表面側のめっき層を覆うレジストマスクを、前記柱状部の上面における前記めっき層周縁に前記銅板が5～30μm露出するように形成することを特徴とする請求項4に記載のリードフレームの製造方法。